

Model : NC-80MAP

非接触式（渦電流法）シート抵抗測定システム

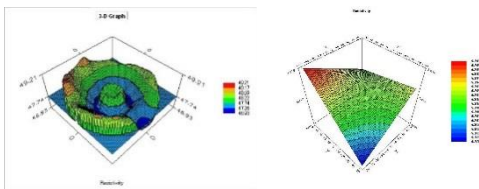


非接触測定でワイドな測定レンジを実現

高精度測定及び2D/3Dマッピング表示を備えたデータ管理機能

機能・特長

- 面内マルチポイント測定機能
(プログラムパターン：Max.217点測定)
*任意のマルチポイントパターン設定可能
- Windows 7 対応の専用ソフトウェア
- 2-D/3-Dマッピング画像表示
(マッピング画像はJPEG形式で保存)
- SPCチャート表示機能
- 測定データはCSVファイル形式で出力可能
- 国際標準規格：ASTM F653準拠



測定対象

- ウエハサンプル；
シリコンベア、化合物、エピ、拡散層、
SiCなど
- 各種薄膜サンプル；
半導体プロセス膜、メタル膜、ITO膜など
- その他
*原則として測定レンジ内であれば、どんな
サンプルでも測定可能

対象サイズ

サイズ：2～8インチ、156mm□
厚さ：300～1,500μm

測定レンジ

プローブタイプ	測定レンジ
(1) Super Low	0.005 ~ 0.01 ohm/sq
(2) Low	0.01 ~ 0.5 ohm/sq
(3) Middle	0.5 ~ 10 ohm/sq
(4) High / Super High	10 ~ 3000 ohm/sq

*プローブコア径（測定スポット径）：14 mm (S-Low, Lowは5mm対応も可能)



測定直線性

測定レンジ	%
0.005 ~ 0.01 ohm/sq	±3 %
0.01 ~ 0.05 ohm/sq	±2 %
0.05 ~ 10 ohm/sq	±2 %
10 ~ 1000 ohm/sq	±2 %
1000 ~ 3000 ohm/sq	±3 %

測定再現性

測定レンジ	%
0.005 ~ 0.01 ohm/sq	0.7 %
0.01 ~ 0.05 ohm/sq	0.7 %
0.05 ~ 10 ohm/sq	0.7 %
10 ~ 1000 ohm/sq	1 %
1000 ~ 3000 ohm/sq	3 %

*測定再現性：CV = STDEVP/AVG×100% で計算。
(標準抵抗サンプル：NIST・VLSIを使用し、同一点を10回繰返し測定)

測定スループット

測定点数	測定時間（トータル）	測定時間（1点あたり）
5(-)	17s(±1s)	3.4s
5(+)	21s(±2s)	4.2s
9(+)	24s(±2s)	2.67s
17	45s(±3s)	2.65s
37	70s(±3s)	1.89s
73	125s(±5s)	1.71s
121	195s(±10s)	1.61s
217	320s(±10s)	1.47s

*測定時間はφ4"ウエハ、測定プローブ指定設定の場合です。

☆弊社ウェブサイトに本製品のムービーを掲載しております。[リンク](#)よりご覧下さい。

- 詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 実機でのサンプル測定が可能です。お気軽にご相談下さい。
- 記載の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。